



72Ge in Form von Germaniumtetrafluoridgas GeF4

Beschreibung

Angereichertes Germaniumtetrafluoridgas wird als präamorphes Implantat verwendet, um zu verhindern, dass Dotierstoffkanäle in den Siliziumwafern implantiert werden. Außerdem wird es verwendet, um die Siliziumscheibe zu belasten, was die Leistung und Geschwindigkeit des Geräts optimiert.

Isotopic Abundance:

	Item	70Ge	72Ge	73Ge	74Ge	76Ge
Abundance (%)	GC-MS (±0.5)	8.78	65.02	12.81	13.37	0.02

RGA Analysis

Component Analysis	Specification	Detect Limit	Units	Analysis Method
GeF4 Purity	≥99.99	/	% by Volume	GC-MS
72Ge	≥55%	0.0001	AT%	GC-MS
O2	≤25	0.1	ppmv	GC-MS
N2	≤25	0.1	ppmv	GC-MS
CO2	≤25	0.1	ppmv	GC-MS
SO2	≤25	0.1	ppmv	GC-MS
HF	≤25	0.1	ppmv	GC-MS
Ar	≤25	0.1	ppmv	GC-MS